

ダイオキシン類対策特別措置法に係る水質関係特定施設

| 特定施設 | | 排出基準 [pg-TEQ/L] | 公害防止管理者 選任の要否 | |
|------|--|--------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 硫酸塩ハルブ(クラフトハルブ)又は亜硫酸ハルブ(サルファイトハルブ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 | 10 | 要 | |
| 2 | カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 | | | |
| 3 | 硫酸カウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 | | | |
| 4 | アルミ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 | | | |
| 5 | 担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 | | | |
| 6 | 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 | | | |
| 7 | カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの | | | イ 硫酸濃縮施設 ロ シクロヘキサン分離施設 ハ 廃ガス洗浄施設 |
| 8 | クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの | | | イ 水洗施設 ロ 廃ガス洗浄施設 |
| 9 | 4-クロロフル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの | | | イ ろ過施設 ロ 乾燥施設 ハ 廃ガス洗浄施設 |
| 10 | 2,3-ジクロロ-1,4-ナフキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの | | | イ ろ過施設 ロ 廃ガス洗浄施設 |
| 11 | ジオキサジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの | | | イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設 ニ 熱風乾燥施設 |
| 12 | アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの | | | イ 廃ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設 |
| 13 | 亜鉛の回収の用に供する施設のうち、次に掲げるもの | | | イ 精製施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設 |
| 14 | 担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの | | | イ ろ過施設 ロ 精製施設 ハ 廃ガス洗浄施設 |
| 15 | 廃棄物焼却炉(火床面積0.5m ² 以上又は焼却能力50kg/h以上)から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの | | | イ 廃ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設 |
| 16 | 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設、PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | | | 不要 |
| 17 | フロン類(CFC及びHCFC)の破壊(プラズマ反応法、廃棄物混焼法、液中燃焼法及び過熱蒸気反応法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの | | イ プラズマ反応施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設 | |
| 18 | 下水道終末処理施設(第1号～17号、19号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。) | | | |
| 19 | 第1～17号に掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設 | | | |